ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОГА ГЕНЕРАЦИИ И ВНУТРЕННИЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕТЕРОЛАЗЕРОВ НА ZnCdSe

В. С. Полищук¹, В. К. Кононенко²

¹Белорусский государственный университет, Минск ^лИнститут физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск

Гетероструктуры на широкозонных полупроводниках могут служить основой для создания лазерных диодов и светодиодов синезеленого спектрального диапазона (490-530 нм) [1, 2]. Лазеры на синюю область спектра изготавливаются на нитридах металлов III группы [3]. В зеленой же области излучения лучшими характеристиками обладают лазерные диоды на широкозонных халькогенидах [4]. Дальнейшее улучшение параметров и работоспособности инжекционных лазеров на соединениях А^{II}В^{VI} требует, прежде всего, снижения электрического сопротивления контактов к р-слоям. Важной задачей остается подбор новых материалов для волноводных областей гетероструктуры, а также поиск эффективных способов отвода тепла из активной области.

В данной работе проанализированы спектральные, пороговые и температурные характеристики гетеролазеров в системе ZnCdSe-ZnSSe. Как показано, в зависимости от коэффициента потерь может быть подобрано оптимальное число квантовых ям в активной области и определена предельная рабочая температура гетеролазера.

Активная область гетероструктур, излучающих на длине волны 505 нм, содержит квантовые ямы $Zn_xCd_{1-x}Se$, барьерные слои ZnS_ySe_{1-y} и обкладочные слои $Zn_zMg_{1-z}S_uSe_{1-u}$, где х = 0.8, y = 0.06, z = 0.91 и u = 0.11. При ширине квантовых ям d = 6.5 нм имеем, соответственно, следующие уровни размерного квантования для электронов и тяжелых и легких дырок: $E_{c1} = 32.2$ мэв, $E_{c2} = 124.2$ мэв, $E_{c3} = 245.4$ мэв, $E_{vh1} = 8.6$ мэв, $E_{vh2} = 31.9$ мэв, $E_{vl1} = 19.3$ мэв. Оптические переходы начинаются с энергий hv_{ni} , где номер подзон n = 1, 2, индекс i = h, l соответствует тяжелым и легким дыркам.

Расчеты спектров испускания проводились в приближении эффективной массы ($m_c = 0.16m_e, m_{vh} = 0.54m_e, m_{vl} = 0.14m_e$). Максимум спонтанного испускания при накачке вблизи порога генерации соответствует энергии переходов электрон-легкая дырка (n = 1). При этом усиление TE-моды больше, чем TM-моды, и основные переходы - это переходы электрон-тяжелая дырка (n = 1). Максимальный коэффициент усиления κ (TE-мода) при стационарной генерации удовлетворяет условию $\Gamma \kappa = \kappa_n$. Из оптимизации параметра оптического ограничения Γ в зависимости от толщины барьерных слоев d_b следует, что значение Γ максимально при

 $d_b = 0.075$ мкм ($\Gamma = 0.0199$) [5]. Оптимальное число квантовых ям достигает N = 3-5.

Анализ зависимости плотности порогового тока генерации /_п от температуры T и коэффициента потерь к_п (рис. 1 и 2) показывает, что при низких рабочих температурах (T < 150 K) предпочтительнее лазерные диоды с одной квантовой ямой. Для температур 250-400 K более оптимальны гетероструктуры с тремя квантовыми ямами.



Рис. 1. Зависимость /_п(κ_{n}) при *T* = 100 (1), *Рис. 2.* Зависимость jn(T) при $\kappa_{n} = 0$ (1), 20 150 (2), 200 (3), 250 (4), 300 (5), 350 (6) и (2) ,40 (3), 60 (4), 80 (5) и 100 см⁻¹ (б), 400 K (7), *N* = 1 N = 3

Нагрев активной области AT и предельные рабочие характеристики лазера можно оценить, определяя рассеиваемую в диоде тепловую мощность и зная теплофизические параметры слоев гетероструктуры [6]. Для рассматриваемых гетероструктур имеем AT = s/ n (R₀ / n + hv ц' /e)R_T, где удельное электрическое сопротивление $R_0 = 10^{\circ} \text{ °Cm}^2 \text{ сm}$, площадь контакта $s = 2.5 \times 10^{2}$ см , инжекционная эффективность 1, v - частота генерации. Тепловое сопротивление гетеролазера составляет $R_T = 100 \text{ K/BT}$, если диод расположен на хладопроводе подложкой вниз и $R_T = 40 \text{ K/BT}$, если - подложкой вверх [4].

Из расчетов следует, что плотность порогового тока /_п зависит от температуры *T* практически линейно: /_п = A(T + AT), где нагрев AT = B/ n (/ n + C). Коэффициенты A, *B* и *C* зависят от параметров материала, электрических и оптических характеристик лазерного диода. Таким образом, необходимое условие стационарной генерации имеет вид $a46 (2n/\Gamma + 4bc) < 1$, т. е. должно выполняться ABC < 1 и $4A^2BT < 1$.

Из зависимости температуры срыва стационарной генерации T^{\wedge} от коэффициента потерь к_п (рис. 3 и 4) видно, что генерация при комнатной температуре возможна для лазерного диода с одной квантовой ямой, когда потери резонатора меньше 25 и 40 см⁻¹ и конфигурации подложкой

вниз и подложкой вверх соответственно. При этом коэффициент усиления в пороге $\kappa = \kappa_n/\Gamma$ не превышает 1250 и 2000 см⁻¹. Для лазера с тремя квантовыми ямами и конфигурации подложкой вниз стационарная генерация при комнатной температуре невозможна (при минимальном $\kappa_n = 0$ предельная температура T_{cp} ниже 300 К и составляет порядка 200 К). Для лазерного диода, расположенного на хладопроводе подложкой вверх, κ_n должно быть меньше 30 см⁻¹ и коэффициент усиления в пороге не превышает величины порядка 500 см⁻¹.



Рис. 3. Зависимость $T_{cp}(\kappa_n)$ при N = 1 и кон-*Рис. 4.* Зависимость $T_{cp}(\kappa_n)$ при N = 3 и конфигурации подложкой вверх (1) и вниз (2) фигурации подложкой вверх (1) и вниз (2)

Как видно из рис. 1, зависимость ј от к_п может быть аппроксимирована экспоненциальной функцией ј = $j_0 \exp(bk_n)$, где $j_0 = j^{\wedge}$ и $b = 1/pj_0$. Плотность нулевого тока (тока инверсии) $j_0 \sim AT$, а произведение $Pj_{0_{\Pi}}$ практически не зависит от *T*. При N = I находим $A \ll 0.647$ А/см -К и $b \ll 0.041$ см. При N = 3 значение A возрастает, но параметр b падает почти в три раза: $A \ll 1.94$ А/см -К и $b \ll 0.0124$ см.

Таким образом, наиболее оптимальными рабочими параметрами обладают лазерные гетероструктуры с тремя квантовыми ямами в активной области. Для конфигурации расположения лазерного диода на хладопроводе подложкой вверх коэффициент потерь κ_{π} для достижения стационарной генерации при комнатной температуре должен составлять менее 30 см⁻¹.

- Haase M. A., Qiu J., Depuydt J. M., et al. // Appl. Phys. Lett. 1991. V. 59, №.11.
 P. 1272-1274.
- 2. Mensz P M. // J. Crystal Growth. 1994. V. 138, №. 1-4. P. 697-702.
- 3. Nakwaski W. // Opto-Electron. Rev. 1998. V. 6, №. 2. P. 93-110.
- Drenten R. R., Haberem K. W., Gaines J. M. // J. Appl. Phys. 1994. V. 76, №. 7. P. 3988-3993.
- 5. Полищук В. С., Кононенко В. К. // Лазерная и оптоэлектронная техника. Сб. науч. ст. Вып. 7. Мн.: БГУ, 2002. С. 46-52.
- 6. Кононенко В. К., Пак Г. Т. // Письма ЖТФ. 1982. Т. 8, № 12. С. 750-754.